

ATC施設利用・共同開発研究申請書(■新規 □継続 □変更)

国立天文台先端技術センター センター長 殿

平成31年3月28日

下記のとおり施設利用を申請します。

①代表者氏名： 小林行泰		④ 連絡先：(E-mail)	
② 所属機関 / 部局 光赤研究部		(電話)	
③ 職名 又は 学年 名誉教授		(FAX)	
⑤ 研究課題名：スペckルマスキング法の応用			
⑥ 研究課題および施設利用の目的		URL (省略可): http://	
太陽像の撮像においてスペckルマスキング法は極めて有効であることが示されている(Ichimoto et al. 2014)。スペckルマスキング法によりシーイングによって解像度の劣化した観測画像から本来の輝度分布を再現することが可能であり、太陽面のような広い視野にわたって有効である。そこで太陽像以外の画像へのスペckルマスキング法の適応可能性を実験したい。まずは、卵酉儀を用いて月面画像を取得しスペckルマスキング手法の適用を試みる。撮像には備え付けの望遠鏡、あるいは所有している望遠鏡に一眼レフカメラを装着して行う。			
⑦ 希望利用期間：H31 年 4 月 1 日 ~ H32 年 3 月 31 日 (継続使用の場合は、一年毎の更新が必要です。)			
⑧ 利用者およびその連絡先(電話番号、E-Mail)			
先端技術センターの関連職員の氏名を記入。(該当者がいない場合は記入不要)			
利用設備の申請 : 使用する項目にチェック(☑ or ■)を入れてください。			
☐ メカニカルエンジニアリングショップ 業務依頼の内容を具体的に裏面に記入してください。	☐ 設計	☐ 実験スペース	__ × __ m ²
	☐ 工作依頼	☐ 電源の使用	100V, __A, __口
	☐ 測定・評価		200V, __A, __口
	☐ 超精密	☐ クレーンの利用	この欄に利用クレーンの規模を記入して下さい。
☐ オプティカルショップ	測定器の予約はWebを利用して下さい。	☐ 特定化学物質	この欄に物質名を記入して下さい。
☐ スペースチャンバーショップ 裏面に作業内容を記入してください	☐ 大型スペースチャンバ ☐ 中型真空チャンバ ☐ 小型真空チャンバ ☐ その他()	☐ 有機溶剤	この欄に使用する溶剤の種類を記入して下さい。持ち込む場合は、別途届出用紙に記入して提出して下さい。
		☐ 高圧ガス	別途届出用紙に記入して提出。
☐ 特殊蒸着・超微細加工ユニット 裏面に依頼内容を記載してください。	☐ 特殊蒸着	☐ 液体窒素: xx ㍓/月	☐ 乾燥窒素
	☐ 微細加工	☐ 液体ヘリウム: xx ㍓/月	ここに推定月使用料を記入して下さい。
☐ クリーンルーム (CR) 裏面に作業内容を記入して下さい	☐ 大型CR(クラス1,000) ☐ 中型CR(クラス10,000) ☐ 小型CR(クラス10,000)	☐ 真空ポンプ 設備管理ユニットに予め相談必 ☐ エレクトロニクス測定機器利用	☐ 冷却水の利用 ☐ サブミリ波FTS
	☒ その他 (卵酉儀)		
安全衛生講習 : 希望しない		保険加入の有無(学生のみ): 有 ・ 無	

申請事項に変更が生じた場合は、速やかに変更申請書を作成し提出願います。

送付先(先端技術センター事務): atc-office@atc.mtk.nao.ac.jp